

ストレージ・ナノフォトニクス技術開発の歩み

2008 (H20) 年度 2009 (H21) 年度 2010 (H22) 年度 2011 (H23) 年度 2012 (H24) 年度 2013 (H25) 年度 2014 (H26) 年度 2015 (H27) 年度 2016 (H28) 年度 2017 (H29) 年度 2018 (H30) 年度 2019 (H31) 年度

NEDO特別講座「ナノフォトニクスを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開」(東大)

革新的部材産業創出プログラム (H18~H22年度)
 新産業創造高度部材基盤技術開発
 a. 低損失オプティカル新機能部材技術開発
 b. 次世代光波制御材料・素子化技術
 c. 革新的マイクロ反応場利用部材技術開発

(1大学、2企業、1組合)
 東大、シグマ光機、
 光ストレージ技術研究組合、
 昭和電工

METI
 H22年度レアース等
 利用産業等設備
 導入事業

「革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)」提案
 (東大、日立ソリューションズ、ブイ・テクノロジー)

「エネルギー・環境新技術先導プログラム」提案
 (東大、ソディック)

NEDO
 「エネルギー・環境新技術先導プログラム」
 (H26~H28年度)
 東京理科大(H26~28年度)、
 三菱化学(H26~27年度)、
 大日本印刷(H26~27年度)

低損失オプティカル新機能部材技術開発(H18~H22年度)

★ ナノフォトニクス推進機構

①基盤技術研究開発
 (1)ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術
 (2)ナノ構造部材作製技術
 (3)ナノ構造部材評価技術
 (4)ナノ構造部材オプティカル新機能応用技術
 ②ナノ構造を用いた偏光制御部材研究開発
 (1)ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術
 (2)ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術
 (3大学6社参加)
 東大、東工大、東高専、
 コニカミノルタオプト、東芝、バイオ
 ニア、日立製作所、日立マクセル、
 リコー

(1大学、1企業)
 東大、ブイ・テクノロジー

NEDO
 社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト
 ([4]研究成果等の他分野での先導研究)
 (H25年度)

「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」提案
 (ブイ・テクノロジー、日立LGデータストレージ、東大)

SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)
 「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」提案
 (東大)

NEDO
 太陽エネルギー技術開発/太陽光システム次世代
 高性能技術の開発(H24~H26年度)

東大、三菱化学

「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」提案
 (ブイ・テクノロジー、東京エレクトロデバイス)

大容量ストレージのための
 ナノマスタリング技術の研究開発
 (H19~H21年度)

継続研究
 (H22年度)

(3社参加)
 東芝、バイオニア、日立製作所

(2社参加)
 東芝、日立製作所

実用化に向けた活動継続(H15年度~)

実用化に向けた活動継続(H19年度~)

実用化に向けた活動継続

NPO法人ナノフォトニクス工学推進機構
 (H17.4.14設立)

光ストレージ技術研究組合

H21年7月設立

H24年3月解散

★
 IDW' 14 (International Display
 Workshops) 出展